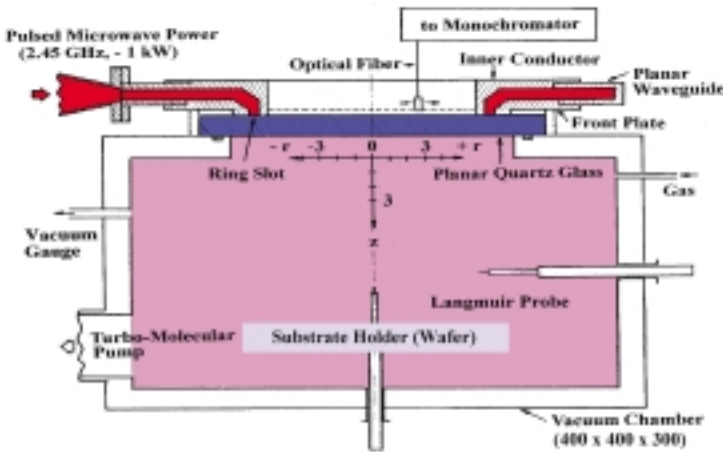


高密度・低温・高均一・大口徑プラズマ

東洋大学工学部電気電子工学科 岡本幸雄

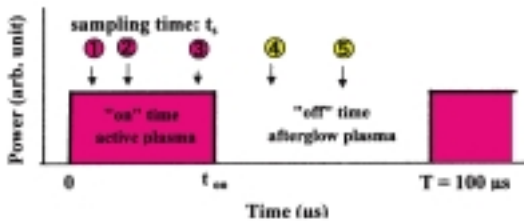
Surface-wave Mode



Experimental setup.

薄膜の創製やエッチングなどのための制御された新しいプラズマソースの研究開発を進めている。

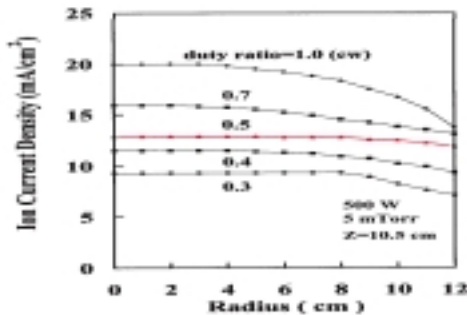
シンプルなリングスロット構造の表面波励起型方式と電力をパルス変調して印加する方式により、下記のように優れたプラズマを生成することができる。



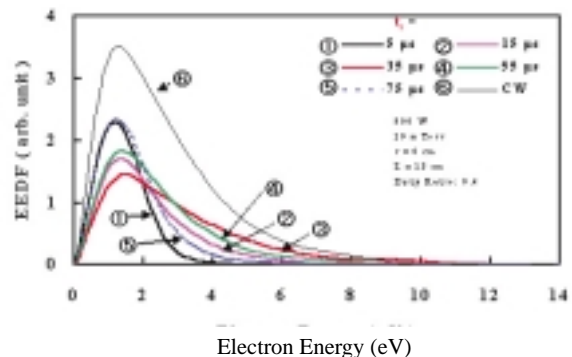
主な実績

- * 特許：(1) パルス変調: 日本特許No.2792558 (1987)
- (2) Ring-slot プラズマ装置: 特願昭2001-003286
- * 詳細：(1) Vacuum , 66 (2002) 359.
- (2) Jpn. J. Appl. Phys., PT2, vol.42, No.9AB (2003) be in press.

電子密度 $10^{11}/\text{cm}^3$, 電子温度 2eV



Radial distribution of ion current density.



Temporal evolution of electron energy distribution function (EEDF).

連絡先 〒350-8585 川崎市鯨井2100 TEL & FAX 049-239-1349
E-mail: okamoto@eng.toyo.ac.jp